JP60-049252A(1985)

# **PATENT ABSTRACTS OF JAPAN**

(11)Publication number:

60-049252

(43)Date of publication of application: 18.03.1985

(51)Int.CI.

G01N 23/225

H01J 49/14

(21)Application number : **58-157694** 

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH

CORP < NTT >

(22)Date of filing:

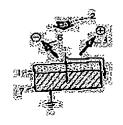
29.08.1983

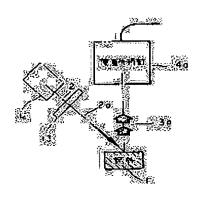
(72)Inventor: NAGAI KAZUTOSHI

**KUWANO HIROKI** 

(54) MASS SPECTROMETER WITH SECONDARY ION

This Page Blank (uspin)





## (57) Abstract:

PURPOSE: To suppress electrification on sample surface and to improve accuracy of mass spectrometry by pulsing primary ion and irradiating a sample with the pulse ions.

CONSTITUTION: When primary ion 2 collides against a sample 1, secondary ion 3 and secondary electron 6 are released. A shutter 13 may be an electrical shutter or mechanical shutter. In other words, any shutter is usable as far as the shutter can convert the continuous primary ion 2 to impulsive primary ion 2a. The pulse width of the primary ion 2a is equal to the open time (t) of the shutter 13 and the open time (t) is so determined that the product it of the current (i) flowing in the sample 1 and the time (t) attains a constant or below. If the pulse

interval of the primary ion 2a is taken substantially long, the charge accumulated in the sample 1 is discharged and the surface potential V of the sample 1 is maintained low by which the exact mass spectrometry is accomplished.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

This Page Blank (Legion)

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

This Page Blank (uspro)

# MASS SPECTROMETER WITH SECONDARY ION

Patent number:

JP60049252

**Publication date:** 

1985-03-18

Inventor:

NAGAI KAZUTOSHI; KUWANO HIROKI

Applicant:

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

Classification:

- international:

G01N23/225; H01J49/14

- european:

H01J49/14A

Application number:

JP19830157694 19830829

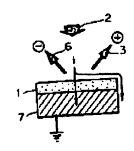
Priority number(s):

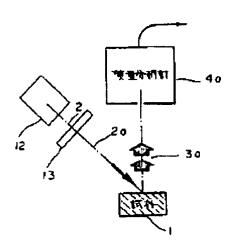
JP19830157694 19830829

# Report a data error here

## Abstract of **JP60049252**

PURPOSE: To suppress electrification on sample surface and to improve accuracy of mass spectrometry by pulsing primary ion and irradiating a sample with the pulse ions. CONSTITUTION: When primary ion 2 collides against a sample 1, secondary ion 3 and secondary electron 6 are released. A shutter 13 may be an electrical shutter or mechanical shutter. In other words, any shutter is usable as far as the shutter can convert the continuous primary ion 2 to impulsive primary ion 2a. The pulse width of the primary ion 2a is equal to the open time (t) of the shutter 13 and the open time (t) is so determined that the product it of the current (i) flowing in the sample 1 and the time (t) attains a constant or below. If the pulse interval of the primary ion 2a is taken substantially long, the charge accumulated in the sample 1 is discharged and the surface potential V of the sample 1 is maintained low by which the exact mass spectrometry is accomplished.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# <sup>®</sup> 公開特許公報(A) 昭60-49252

6)Int Cl.4

織別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)3月18日

G 01 N 23/225 H 01 J 49/14 2122-2G 6680-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

**匈発明の名称** 二次イオン質量分析計

②特 願 昭58-157694

**29出 願 昭58(1983)8月29日** 

**69発明者 長井 一敏** 

武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話公社武蔵野電

気通信研究所内

砂発 明 者 桑 野 博 喜

武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話公社武蔵野電

気通信研究所内

⑪出 願 人 日本電信電話公社

砂代 理 人 弁理士 志賀 正武

明 細 1

# 1. 発明の名称

二次イオン質量分析計

## 2. 特許請求の範囲

一次イオン発生手段より出力された一次イオンによつて試料を衝撃し、このときに発生する二次イオンに茲づいて質量分析を行う二次イオン質量分析計において、前記一次イオン発生手段より出力された一次イオンをパルス状の一次イオンに変換于段を具備し、前記パルス状の一次イオンによつて前記試料を衝撃することを特徴とする二次イオン質量分析計。

#### 3. 発明の評細な説明

この発明は、北気絶緑性の高い材料の組成分析 を容易に行うことのできる二次イオン質扱分析計 に関する。

周知のとおり、固体材料の組成分析には二次イオン製品分析計が費用されている。第1 図は、従来形の二次イオン製量分析計の構成を示す概略図

である。図において、1は飲料である。飲料1は、 20KeVに加速された一次イオン2によつて打たれ、飲料1からは二次イオン3が放出される。 この二次イオン3は質量分析計4に導入されて質量分析を受け、質量分析計4からは質量スペクトル5が出力される。そして、この質量スペクトル5から二次イオン3の質量と強度を同定し、飲料1の組成分析を行う。

ところで、上述した従来の二次イオン質量分析 計を使用する場合、試料1が金属または半導体な らは問題はないが、電気絶縁性の高い物質のとき には分析が困難になるという欠点があつた。すな わち、試料1は絶縁性であるために、一次イオン 2が当つたときに電荷が蓄積され、その表面単位 が急速に上昇する。このため、後続の一次イオン 2の入射が妨げられるとともに、放出される二次 イオン3のエネルギ分布が大きく偏つて、質量分析計4の分析能力をはずれてしまい、分析が不能 となる。そこで、従来の二次イオン質量分析計に ないては、試料1の帯間防止策として、一次イオ ン2と同時に電子線を照射して蓄積された電荷を中和する等の方法を採つてきたが、電子銃からの 熱闘射および電子衝撃による発熱等のために試料 1が変質し、分析結果に大きな誤差が入つてしま うなどの欠点があつた。

との発明は、上記の事情に鑑み、正確な質量分析を行うことのできる二次イオン質量分析計を提供するもので、一次イオンをパルス化して照射することにより、試料の帯型を防止したことを特徴とする。なお、一次イオンのパルス照射にともなって二次イオンもパルス状に発生するが、これは飛行時間形質量分析計で分析するようにした。

以下、図面を参照して本発明を詳細に説明する。まず、本発明の原理を説明する。第2図())は、 総線性就料1に一次イオン2が入射しているとき の概要を示す断面図である。図において、試料1 に一次イオン2が衝突すると、試料1からは二次 イオン3と二次電子6が放出され、試料1に配流 1が流れ、試料ホルダ7を介してアースに吸収さ れる。この場合、電流1は一次イオン2と二次電

次に、スイッチ11をオフすなわち、一次イオン2の照射を停止すると、試料1の表面配荷は第3図(イ)に示す等価回路の抵抗8、10を介して放電を開始する。今、一次イオン2の照射によつて表面電位VがV。になつた時点で照射を停止したとすれば、以後の表面電位Vは、

$$V = V_0 + x p \left\{ -\frac{t}{C(r_1 + r_2)} \right\}$$
 .....(2)

に従つて被する。第3図(P)はこの関係をクラフに 炎わじたものである。

$$V = 2.5 \times 10^{12} i \{ 1 - e \times p (-\frac{t}{125}) \}$$
 ....(1a)

子6の加算配流であるが、一般に後者の10°~10<sup>-4</sup> 程度なので、電流1は一次イオン2の電流とみなしてよい。第2図向は、このときの脱気的等価回路を示す図である。図において、8は試料1の表面の組織抵抗(すなわち試料1の表面では抗の合成抵抗;値r.9、9は試料1の表裏間の静電容量(値C)、10は静電容量9の直列抵抗分(値r.)、11は一次イオン照射中オンとなるスイッチである。

との等価回路において、スイッチ11のオン/オフは一次イオン2の照射開始/照射停止を意味している。今、スイッチ11がオン、すたわち一次イオン2の照射が開始されると、試料1には一定電流1が流れ、その表面電位Vは時間tの経過につれて、

$$V = r_{21} \left(1 - \frac{r_{2}}{r_{1} + r_{2}} + r_{2} + r_{2} + \frac{t}{C(r_{1} + r_{2})}\right) \cdots (1)$$

のごとく上昇し、最終的には値 r 1 1 に漸近する。 第2図付は、この関係をグラフに表わしたもので ある。

となる。また②式に代入すると、

$$V/V_0 = e \times p \left(-\frac{t}{12.5}\right)$$
 .....(2a)

となる。そして、第4図において(1a)式の関係は実線で、(2a)式の関係は点線で示され、(1a)式のVが左接軸に、(2a)式のV/V。が右縦軸に各々示されている。この図からわかるように、間流1が1×10°A(1nA)であつても照射開始1秒後には表面配位Vは200Vにも違してしまうのに対し、V/V。が10°まで減少するには、100秒近くもの時間を要する。そして、実際の二次イオン質量分析においては、装面配位Vが1~2Vを超えると、分析に悪影響が出始める。

そとで、本発明は、一次イオン2をパルス的に 照射し装面配位 V の上昇を抑制する。例えば上記 の例の場合、配流 1 が 1 n A のときは一次イオン 2 のパルス幅を 1 び わに、 1 0 n A のときは 1 0<sup>-3</sup> 砂にすれば、装面配位 V を 2 V に抑えることができる。この場合、パルス間隔を充分に及く とり、批料 1 の装面に蓄積された電荷の放配を十 分に行うことは勿論である。

次に、第5図を参照して本発明の一実施例を説 **明する。図において、12は一次イオン発生手段** であり、一次イオン2を連続的に発生するもので ある。この一次イオン2は、シャツタ13によつ てパルス状の一次イオン2 B に変換され、試料1 **に照射される。ととで、シャッタ13は電気的シ** ヤツタでも、機械的シヤツタでもよく、要は連続 的な一次イオン2をパルス状の一次イオン2ac 変換できるものであればよい。そして、一次ィオ ン2 aのパルス幅はシヤツタ1 3 の開放時間 t と 等しく、 欧科 1 を流れる 電流 1 ( これは前述した ように一次イオン2aによる電流とみなせる)と 前紀開放時間tとの積iXtが定数以下になるよ うに開放時間もを定める。本実施例においては、 電流 1 = 1 n A と 開放時間 t = 1 0~2 秒 との 稜 1 × 1 0 <sup>-11</sup>クーロンを前記定数としている。

さて、パルス状の一次イオン2aによつて、試料1からはパルス状の二次イオン3aが放出される。との二次イオン3aは飛行時間形質量分析計

す断面図、同図(中は代)の電気的等価回路図、同図(中)は表面電位 V の時間的変化を示すグラフ、第 3 図(中)は番値電荷の放電を説明するための等価回路図、同図(中)は放電時の表面電位 V の時間的変化を示すグラフ、第 4 図は一次イオン照射による溶験石英板の表面電位 V の時間的変化を示すグラフ(実線は一次イオン照射時、点線は放電時)、第 5 図は本発明の一実施例の構成を示す概略図である。

1 ····· 試料、2 ····· 一次イオン、2 a ····· バルス 状の一次イオン、3、3 a ····· 二次イオン、1 2 ····· 一次イオン発生手段、13 ····· シャッタ(変 換手段)。

出願人 日本電信 记售 公社代则人 沪理士 志 贺 正 武

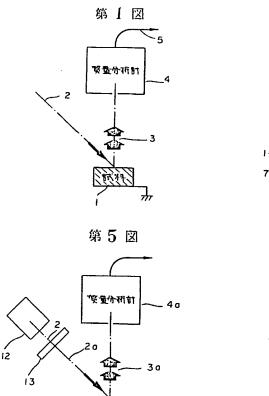
4 a に導入されて分析され、質量分析計 4 a からは質量スペクトル 5 a が出力される。そして、との質量スペクトル 5 a に基づいて試料 1 の組成分析が行われる。

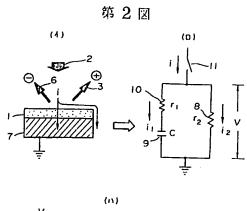
このような構成において、一次イオン2 aのパルス間隔を充分に長くとれば、一次イオン2 aの前回パルスの照射によつて試料1に蓄積された間荷が放電されてから、次のパルスによる照射がなされるので、試料1の表面配位 V を低く(2 V 以下に)保つことができ、正確な質量分析を行うことができる。

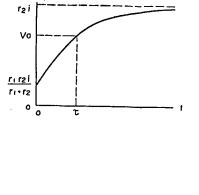
以上説明したようにこの発明は、一次イオンをパルス化して試料を照射するようにしたので、試料要面の帯電が抑制され、表面電位が上昇しないため、質量分析が正常に遂行される利点が得られる。

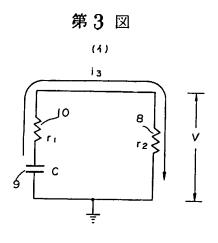
#### 4. 図面の簡単な説明

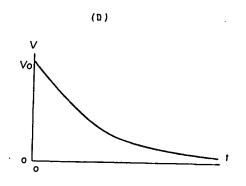
第1図は従来の二次イオン質量分析計の動作原理を説明するための概略図、第2図(イ)は絶縁試料1に一次イオン2が入射しているときの概要を示



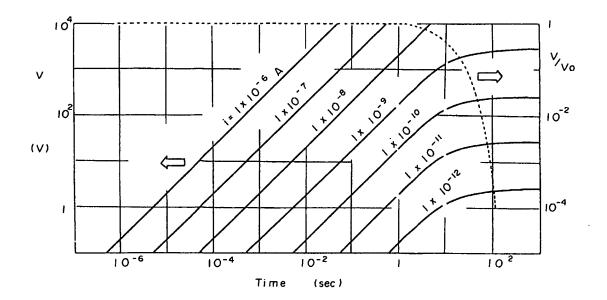








第4図



This Page Blank (uspic)